V. 68, N 4

JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY

July --- August 2001

НЕЛИНЕЙНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛЕГИРОВАННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СВЕРХРЕШЕТКАХ^{**}

Д. В. Ушаков^{а*}, В. К. Кононенко⁶, И. С. Манак^а

^а Белорусский государственный университет,

220050, Минск, просп. Ф. Скорины, 4; e-mail: UshakovDV@rfe.bsu.unibel.by ⁶Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск

(Поступила 5 февраля 2001)

Для легированных полупроводниковых сверхрешеток проанализированы эффекты насыщения поглощения и изменения показателя преломления в зависимости от уровня их возбуждения и конструктивных параметров. Расчеты проведены с учетом хвостов плотности состояний и экранирования электростатического потенциала. Показано, что в легированных сверхрешетках может наблюдаться "затемнение", т.е. увеличение коэффициента поглощения на фиксированной частоте при возрастании интенсивности света. Для &-легированных сверхрешеток проявляется более сильная по сравнению с типичными структурами немонотонность изменения показателя преломления с ростом уровня возбуждения.

Ключевые слова: легированная сверхрешетка, насыщение поглощения, параметр нелинейности, показатель преломления.

Полупроводниковые структуры на легированных сверхрешетках привлекают внимание широкими возможностями перестройки их характеристик как при изменении конструктивно-технологических параметров сверхрешетки, так и при возбуждении структуры. Поочередное легирование полупроводника донорными и акцепторными примесями приводит к модуляции краев зоны проводимости и валентной зоны, в результате чего уменьшается эффективная ширина запрещенной зоны E_g' и образуются периодически повторяющиеся пространственно разнесенные потенциальные ямы для электронов и дырок. Глубина и профиль потенциальных ям определяются толщиной слоев *n*- и *p*-типа d_n и d_p , концентрацией доноров и акцепторов N_d и N_a , толщиной нелегированных *i*-слоев d_i , а также двухмерными концентрациями неравновесных электронов *n* и дырок *p* [1].

При возбуждении легированной сверхрешетки заряд донорных и акцепторных примесей экранируется неравновесными носителями тока, что вызывает уменьшение глубины потенциальных ям и, соответственно, увеличение эффективной ширины запрещенной зоны. Зависимость E_g' от уровня возбуждения структуры обусловливает наблюдаемый сдвиг в область больших энергий длинноволнового края спектров поглощения и люминесценции легированных сверхрешеток на GaAs [2-5].

Изменение свойств легированных сверхрешеток в зависимости от концентрации неравновесных носителей тока приводит к нелинейным оптическим эффектам. В частности, на заданной частоте света v наблюдается зависимость коэффициента поглощения k(v) и показателя преломления $n_i(v)$ от интенсивности света [6, 7]. Перестройка спектров поглощения и рефракции может осуществляться как при оптическом возбуждении, так и при приложении электрического напряжения к структуре. В данной работе рассмотрены особенности изменения коэффициента поглощения и показателя преломления в легированной сверхрешетке в зависимости от плотности возбуждающего излучения.

Насыщение поглощения. Как известно, насыщение мощности поглощения или усиления света связано с уменьшением коэффициента поглощения или усиления на фиксированной частоте света v с ростом амплитуды напряженности электромагнитного поля. В полупроводниковых системах этот эффект обусловлен приближением разности квазиуровней Ферми ΔF к энергии фотонов hv при увеличении интенсивности монохроматического излучения. Особенности нелинейного поглощения или усиления света а нализировались ранее для объемных полупроводников [8—10] и квантоворазмерных систем [11—13]. Для легированных полупроводниковых сверхрешеток данный эффект изучен не достаточно [6, 7, 14]. Кроме того, не исследовано влияние флуктуаций электростатического потенциала на нелинейные оптические процессы.

УДК 539.293:621.382

Доложено на III Международной научно-технической конференции по квантовой электронике, Минск, 20—22 ноября 2000 г.

Стационарное уравнение, определяющее связь между коэффициентом поглощения или усиления k и плотностью фотонов S, имеет вид [8]:

$$\frac{\eta' j}{ed} = \frac{R_{\text{lum}}}{\eta_{\text{sp}}} \pm v_g k(v) S, \tag{1}$$

где j — плотность тока в расчете на период сверхрешетки d; η' — инжекционная эффективность; η_{sp} — квантовый выход люминесценции; v_g — скорость света в кристалле. Перед вторым слагаемым в уравнении (1) стоит знак "минус" при процессах поглощения и "плюс" — при усилении света. Скорость излучательной рекомбинации R_{lum} определяется интегрированием скорости оптических переходов $r_{lum}(hv)$ по всем энергиям фотонов. Величина $r_{lum}(hv)$ связана со скоростью спонтанной рекомбинации $r_{sp}(hv)$ при заданной температуре T и уровне возбуждения кристалла ΔF соотношением [9]

$$\eta_{\rm um}(h\nu) = \frac{1 - \exp\left(-\frac{\Delta F}{kT}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right)} r_{\rm sp}(h\nu) \, .$$

Общее выражение для скорости спонтанной рекомбинации в случае прямых переходов имеет вид [1]

$$r_{\rm sp}(hv) = \frac{A_{cv}}{\pi \hbar^2 N_{\rm p} d} \sum_{i} m_{ri\perp} \sum_{n} \sum_{m} H_t (hv - hv_{nmiv}) |I_{nmiv}|^2 f_e (E_{crmiv}) f_h (E_{vrmiv}), \qquad (2)$$

где A_{cv} — коэффициент Эйнштейна; N_p — число периодов сверхрешетки; I_{nmiv} — интегралы перекрытия огибающих волновых функций электронов и дырок; $f_e(E_{cnmiv})$ и $f_h(E_{vnmiv})$ — функции распределения Ферми—Дирака для электронов и дырок с энергиями

$$E_{cnmiv} = E_{c0} + \frac{m_{r\,i\perp}}{m_c} \left(hv - E_{g'}\right) + \frac{m_{r\,i\perp}}{m_{v\,i\perp}} E_{cnv} - \frac{m_{r\,i\perp}}{m_c} E_{vimv},$$
$$E_{vnmiv} = E_{v0} - \frac{m_{r\,i\perp}}{m_{v\,i\perp}} \left(hv - E_{g'}\right) + \frac{m_{r\,i\perp}}{m_{v\,i\perp}} E_{onv} - \frac{m_{r\,i\perp}}{m_c} E_{vimv},$$

 E_{c0} и E_{v0} — энергии дна зоны проводимости и потолка валентной зоны; m_c , $m_{vh\perp}$ и $m_{vl\perp}$ — эффективная масса электронов и поперечные компоненты эффективных масс тяжелых и легких дырок соответственно; $m_{rl\perp} = m_c m_{vl\perp}/(m_c + m_{vl\perp})$ — приведенная масса. Для GaAs (с ориентацией плоскости {100}) используем $m_c = 0.067m_e$, $m_{vh\perp} = 0.11m_e$, $m_{vl\perp} = 0.20m_e$. Суммирование в (2) проводится по квантовым числам подзон электронов *n*, дырок *m*, миниподзон v и состояниям тяжелых и легких дырок (i = h, l). Переходы между подзонами начинаются с энергий квантов света $hv_{nmiv} = E_g' + E_{cnv} + E_{vimv}$, связанных с эффективной шириной запрещенной зоны легированной сверхрешетки $E_g' = E_{c0} - E_{v0}$ и энергиями уровней подзон электронов E_{cnv} и дырок E_{vimv} .

Функция $H_t(y)$ определяется уширением энергетического спектра. В отсутствие эффектов уширения в полупроводниковой структуре $H_t(y)$ представляет собой ступенчатую функцию Хевисайда. Для сильнолегированных сверхрешеток примесная и собственная зоны кристалла перекрываются, поэтому появляются хвосты плотности состояний [1]. В случае гауссова хвоста плотности состояний функция $H_t(y)$ имеет вид $H_t(y) = \text{erfc}(-y/\sigma_{cv})/2$ [5], где $\sigma_{cv} = (\sigma_c^2 + \sigma_v^2)^{1/2}$; σ_c и σ_v — характеристические параметры хвостов плотности состояний в зоне проводимости и в валентной зоне. С увеличением уровня возбуждения легированной сверхрешетки хвосты плотности состояний в результате экранирования флуктуирующего примесного потенциала неравновесными носителями тока сокращаются [1, 15].

Коэффициент поглощения k(v) связан со скоростью спонтанной рекомбинации $r_{sp}(hv)$ универсальным соотношением [9]:

$$k(v) = \frac{\exp\left(\frac{hv - \Delta F}{kT}\right) - 1}{v_{\rm g}\rho(hv)} r_{\rm sp}(hv), \qquad (3)$$

где $\rho(h\nu) = (h\nu)^2 n_r^2 / \pi^2 c^2 \hbar^3 v_g$ — плотность электромагнитных мод; n_r — показатель преломления кристалла. Используя выражения (1)—(3), находим зависимость коэффициента поглощения k от плотности фотонов S. В общем случае она подчиняется сложному закону [8]. Если учитывать среднее значение параметра нелинейности α , то изменение коэффициента поглощения (усиления) можно описать простой формулой [8, 9]

$$k = \frac{k_0}{1 + hv\alpha S}, \tag{4}$$

где k₀ — начальный коэффициент поглощения (усиления).

Для более детального анализа эффектов насыщения в конкретных квантоворазмерных структурах необходимы численные расчеты. Для легированных полупроводниковых сверхрешеток расчет нелинейного поглощения удобно проводить по следующему алгоритму [13]. Сначала, задавая разность квазиуровней Ферми ΔF_0 и считая плотность фотонов S = 0, нужно определить соответствующий коэффициент поглощения k_0 на частоте возбуждающего света v и плотность тока *j*. Если *j* = 0, то $\Delta F_0 = 0$. Увеличивая ΔF , находим новые значения коэффициента поглощения *k* и скорости рекомбинации R_{lum} а потом из уравнения (1) рассчитывается соответствующая плотность фотонов *S*. Далее процедура повторяется, пока разность квазиуровней Ферми ΔF не станет равной энергии фотонов *h*v.

Результаты расчетов насыщения поглощения для двух типов легированной сверхрешетки на основе GaAs при j = 0, T = 300 К и $\eta_{sp} = 0.7$ представлены на рис. 1. Вычисления k(v) и $r_{sp}(hv)$ проводились в модели гауссовых хвостов плотности состояний с учетом экранирования флуктуирующего примесного потенциала. Как видно, коэффициент поглощения k на фиксированной частоте v проявляет немонотонное поведение при увеличении плотности фотонов S. Эффект "затемнения", т. е. увеличения коэффициента поглощения k при увеличении плотности фотонов S, обусловлен трансформацией профиля потенциальной энергии легированной сверхрешетки, перераспределением уровней энергии в квантовых ямах для электронов и дырок, изменением интегралов перекрытия волновых функций электронов и дырок, а также сужением запрещенной зоны.



Рис. 1. Насыщение поглощения для легированных сверхрешеток разного типа при различных энергиях фотонов: $a - N_a = 10^{19} \text{ см}^{-3}$, $N_d = 6 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, $d_p = 35 \text{ нм}$, $d_n = 25 \text{ нм}$, $d_i = 0$; $6 - N_a = N_d = 10^{20} \text{ см}^{-3}$, $d_p = d_n = 1 \text{ нм}$, $d_i = 8 \text{ нм}$; l - hv = 0.8 зB, $k_0 = 0.1$ (a) и 0.4 см⁻¹ (b); 2 - hv = 1.1 зB, $k_0 = 20$ (a) и 84 см⁻¹ (b); 3 - hv = 1.4 зB, $k_0 = 1537$ (a) и 2437 см⁻¹ (b)

При отсутствии флуктуаций концентраций примесей будет наблюдаться осцилляционное изменение коэффициента поглощения на фиксированной частоте света в зависимости от уровня возбуждения легированной сверхрешетки [6]. Обычно в легированных сверхрешетках флуктуации электростатического потенциала сглаживают ступенчатообразную плотность состояний, что приводит к гладким спектрам поглощения и испускания [1]. В результате зависимость k(S) становится также гладкой, но область затемнения, которая наиболее четко проявляется при энергиях фотонов порядка ширины запрещенной зоны полупроводника, не пропадает (рис. 1).

Наиболее сильно немонотонный характер насыщения поглощения выражен для δ-легированной сверхрешетки (рис 1, *б*). Для объемных полупроводников затемнение может быть вызвано ростом поглощения свободными носителями [8]. Однако этот процесс практически не влияет на насыщение поглощения в легированных сверхрешетках, так как коэффициент поглощения света свободными носителями при энергиях фотонов порядка эффективной ширины запрещенной зоны сверхрешетки не превышает 5 см⁻¹ [16].

В широком диапазоне изменения плотности фотонов S зависимость k(S) не описывается формулой (4) с постоянным параметром нелинейности α . Оценки параметра α удобнее проводить, используя двойной логарифмический масштаб [8] для зависимости $k_0/k - 1$ от S (рис. 2). Тогда по характеру кривых можно судить об изменении α при разных энергиях возбуждающих квантов hv в зависимости от диапазона плотности светового потока hvv_gS .

Как видно, пороговые потоки просветления, когда коэффициент поглощения уменьшается, например, на 1 %, для легированной сверхрешетки *p*-типа составляют ~10 мВт/см² при hv = 0.8 эВ. При увеличении hv пороги просветления становятся еще меньше. Для δ -легированной компенсированной сверхрешетки наблюдается противоположная картина: с увеличением hv порог просветления возрастает и при hv = 1.4 эВ составляет ~2 кВт/см². Различие связано с разным характером заполнения состояний в зоне проводимости и валентной зоне при оптическом возбуждении сверхрешеток.

С ростом плотности фотонов S параметр нелинейности уменьшается при любой энергии световых



Рис. 2. Зависимость $k_0/k - 1$ от плотности фотонов S при различных энергиях фотонов для легированных сверхрешеток разного типа. Параметры сверхрешеток те же, что на рис. 1, *а* и б, кривые 1-3 соответственно

квантов. Это изменение обусловлено совместным действием сокращения хвостов плотности состояний [10] и увеличения эффективной ширины запрещенной зоны [1]. Последний фактор преобладает для δ-легированных компенсированных сверхрешеток из-за сильного фонового экранирования [5].

При достаточно больших S изменение коэффициента поглощения следует формуле (4) с постоянным значением α [8]. В частности, для энергий фотонов hv = 0.8, 1.1 и 1.4 эВ имеем соответственно $\alpha/v_g = 0.83$, 0.26 и 0.010 см²/кВт для сверхрешетки *p*-типа (рис. 2, *a*). Для таких же энергий фотонов в случае δ-легированной сверхрешетки получаем $\alpha/v_g = 0.10$, 0.028 и 0.0067 см²/кВт (рис. 2, *b*). Как видно, значения α уменьшаются с увеличением hv. Плотность светового потока, при котором коэффициент поглощения становится в 2 раза меньше, варьируется в широких пределах — от 2 Вт/см² в сверхрешетке *p*-типа до 80 кВт/см² в δ-легированной сверхрешетке.

Нелинейная дисперсия. Как показано в работе [7], в легированных сверхрешетках наблюдается более сильная нелинейная рефракция по сравнению с объемными полупроводниками. Различие показателей преломления легированной сверхрешетки на GaAs и объемного полупроводника составляет 0.02. Разность показателей преломления в возбужденном и невозбужденном состояниях легированных сверхрешеток на GaAs достигает 0.003, а на InAs — 0.015. В δ-легированных сверхрешетках может иметь место еще большая нелинейная рефракция [17].

Вычисления дисперсионных характеристик δ -легированной сверхрешетки на GaAs проводились с учетом экранирования электростатического потенциала носителями тока и гауссовых хвостов плотности состояний [5]. Показатель преломления Δn_r на некоторой частоте v_0 определялся из соотношения Крамерса—Кронига:

$$\Delta n_{\rm r}(v_0) = \frac{c}{2 \pi^2} \oint \frac{k(v)}{v^2 - v_0^2} dv.$$

Здесь интеграл берется в смысле главного значения.

Результаты расчетов коэффициента поглощения k(v) и показателя преломления $\Delta n(v)$ представлены на рис. 3. Как видно, с ростом уровня возбуждения ΔF максимум дисперсионной кривой смещается в коротковолновую область на 100 мэВ, что соответствует сдвигу края поглощения из-за роста эффективной ширины запрещенной зоны сверхрешетки.



Рис. 3. Спектры поглощения k(v)(a) и рефракции $\Delta n_r(v)(b)$ для δ -легированной сверхрешетки при различных уровнях возбуждения: $\Delta F = 0.8(1), 1.0(2), 1.2(3)$ и 1.4 эВ (4). Параметры сверхрешетки те же, что на рис. 1, b

На рис. 4 приведены зависимости показателя преломления Δn_r на фиксированной частоте света от разности квазиуровней Ферми ΔF . Для δ -легированной сверхрешетки более сильно проявляется немонотонный характер изменения Δn_r в зависимости от ΔF , особенно для энергий фотонов порядка ширины запрещенной зоны кристалла. При этом изменение показателя преломления на фиксированной частоте с изменением уровня возбуждения сверхрешетки для T = 300 К может достигать 0.02.



Рис. 4. Изменение показателя преломления Δn_r на фиксированной частоте v в зависимости от разности квазиуровней Ферми ΔF : hv = 0.8 (1), 0.9 (2), 1.0 (3), 1.1 (4), 1.2 (5), 1.3 (6) и 1.4 эВ (7). Параметры сверхрешеток те же, что на рис. 1, *а* и б соответственно

Используя соотношение (1), легко определить зависимость Δn_r от плотности возбуждающих фотонов S. При достаточно больших $h\nu$ четко проявляется немонотонность нелинейной рефракции $\Delta n_r(S)$. В предельном случае, очевидно, Δn_r приближается к постоянному значению, соответствующему условию $\Delta F = h\nu$ [8, 13].

Величину Δn_r следует рассматривать как добавку к показателю преломления кристалла, обусловленную размерным квантованием уровней и их заполнением неравновесными носителями тока при возбуждении сверхрешетки. Достаточно большие изменения коэффициента поглощения и показателя преломления в полупроводниковых структурах с легированной сверхрешеткой могут быть использованы в оптических би- и мультистабильных переключателях [18]. Кроме того, такие структуры могут быть встроены в фотонные кристаллы для перестройки резонансов пропускания с целью разработки низкопороговых оптических логических элементов [19].

Работа выполнена в рамках белорусско-российского сотрудничества по проекту Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований № Ф99Р-119.

[1] V.K.Kononenko, I.S.Manak, D.V.Ushakov. Proc. SPIE, 3580 (1998) 10-27

[2] G.Hasnain, C.J.Chang-Hasnain, G.H.Döhler, J.N.Miller, N.M.Johnson, J.R.Whinnery, A.Dienes. Superlattices & Microstruct., 3 (1987) 277-282

- [3] M.Renn, C.Metzner, G.H.Döhler. Phys. Rev. B, 48 (1993) 11220-11227
- [4] C.Metzner, K.Schrüfer, U.Wieser, M.Luber, M.Kneissl, G.H.Döhler. Phys. Rev. B, 51 (1995) 5106-5115
- [5] Д.В.Ушаков, В.К. Гононенко, И.С. Манак. Журн. прикл. спектр., 66 (1999) 711-715
- [6] G.H.Döhler, P.P.Ruden. Phys. Rev. B, 30 (1984) 5932-5944
- [7] P.P.Ruden, G.H.Döhler. Proc. 17th Int. Conf. on Physics of Semiconductors, San Francisco (1984) 535-538
- [8] В.К.Кононенко, В.П.Грибковский. Опт. и спектр., 29 (1970) 975-984
- [9] В.П.Грибковский. Теория поглощения и испускания света в полупроводниках, Минск (1975)
- [10] В.К.Кононенко. Журн. прикл. спектр., 41 (1984) 106-110
- [11] В.К.Кононенко. В сб.: "Лазеры и оптическая нелинейность", Вильнюс (1987) 136-143
- [12] V.K.Kononenko. Phys. Status Solidi (b), 150 (1988) 695-698
- [13] В.К.Кононенко, И.С.Манак, Э.Р.Фурунжиев. Журн. прикл. спектр., 64 (1997) 797-800
- [14] В.К.Кононенко, Д.В.Ушаков. Лазерная физика и спектроскопия: Тез. докл. II Междунар. конф., Гродно (1995) 45—46
- [15] V.K.Kononenko, D.V.Ushakov. Phys. Status Solidi (b), 211 (1999) 743-749

[16] D.V.Ushakov, I.S.Manak, V.K.Kononenko. Abstr. Int. Conf. on Solid State Crystals — Materials Science and Applications, Zakopane (2000) 155

[17] Д.В.Ушаков, В.К.Кононенко, И.С.Манак. Квантовая электроника: Материалы III Междунар. науч.-техн. конф., Минск (2000) 14—17

[18] G.H.Döhler. Proc. SPIE, 1523 (1992) 23-63

[19] В.Н.Гусятников, И.С.Нефедов. Опт. и спектр., 89 (2000) 456-459